

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2024年10月3日(03.10.2024)



(10) 国際公開番号

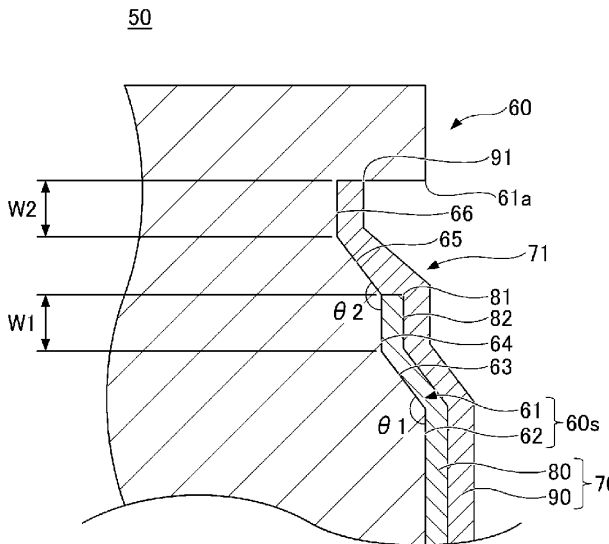
WO 2024/202971 A1

- (51) 国際特許分類:
H01L 21/3065 (2006.01) *C23C 4/06* (2016.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2024/008018
- (22) 国際出願日: 2024年3月4日(04.03.2024)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2023-050764 2023年3月28日(28.03.2023) JP
- (71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(**TOKYO ELECTRON LIMITED**) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 溝井 公亮(**MIZOI, Kosuke**); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).
- (74) 代理人: 伊東 忠重, 外(**ITOH, Tadashige et al.**); 〒1000005 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 丸の内 M Y P L A Z A (明治安田生命ビル) 16階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU,

(54) **Title:** COMPONENT FOR PLASMA PROCESSING APPARATUS, AND METHOD FOR MANUFACTURING COMPONENT

(54) 発明の名称: プラズマ処理装置用の部品、および部品の製造方法

[図3]



(57) **Abstract:** This component for a plasma processing apparatus includes a base material and a sprayed film on a surface of the base material. The surface of the base material includes a main surface and a recess which is recessed with respect to the main surface of the base material at a position overlapping a terminal part of the sprayed film. The sprayed film includes: a first sprayed film provided continuously on the main surface of the base material and a part of the inside of the recess; and a second sprayed film which is formed of a different material from the first sprayed film, and which covers

[続葉有]

LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY,
MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL,
PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK,
SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA,
UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO(BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア(AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告(条約第21条(3))

the first sprayed film by being provided continuously on the first sprayed film and another part inside the recess.

(57) 要約: プラズマ処理装置用の部品は、基材と、前記基材の表面にある溶射膜と、を含む。前記基材の表面は、主面と、前記溶射膜の終端部に重なる位置で前記基材の主面に対して窪む凹部と、を備える。前記溶射膜は、前記基材の主面、および前記凹部の内部の一部に連続して設けられる第1溶射膜と、前記第1溶射膜とは異なる材料により形成され、前記第1溶射膜および前記凹部の内部の他部に連続して設けられることで前記第1溶射膜を覆う第2溶射膜と、を有する。